

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Evaluación Parcial 27 de junio de 2022 Tema 2



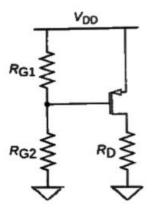
Nombre y apellido:		
Padróu:	Turno:	N° de examen:
- Maria and Haller announced a second	par el parcial que al menos el so ez .	

- Es condición necesaria para aprobar el parcial que in "estos el 60% de cada ejercicio esté correctamente planteado.
- Se considerará: La claridad y síntesis conceptual de las respuestas y justificaciones, los detalles de los gráficos/circuitos, la exactitud de los resultados numéricos.
- · Cada uno de los dos ejercicios debe estar resuelto en hojas independientes.

Calificación:

Constantes: $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$; $h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$; $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $\epsilon_{r,S_1O_2} = 3.9$; $\epsilon_{r,S_1} = 11.7$; $\epsilon_0 = 88.5 \text{ fF/cm}$.

- Respecto de estructuras MOS y transistores MOSFET:
 - a) Considere un capacitor MOS con $t_{\rm ex}=85~{\rm nm}$, $n_{\rm f}=1\times10^{10}~{\rm cm^{-3}}$ ($T=300~{\rm K}$), $W=40~{\rm pm}$, $L=10~{\rm pm}$, y un dopaje en el substrato $N_{\rm A}=1\times10^{16}~{\rm cm^{-3}}$ ($\mu_{\rm n}=1200~{\rm cm^2~V^{-1}~s^{-1}}$), $\mu_{\rm p}=450~{\rm cm^2~V^{-1}~s^{-1}}$). Calcule la carga en la interfaz entre el óxido y el semiconductor, cuando $V_{GB}=2.5~{\rm V}$.
 - b) A partir de la estructura MOS del punto anterior, se construye un transistor MOSFET, agregando el source y el drain y se polariza con |I_D| = 1 mA, |V_{DS}| = 2 V y V_{BS} = 0 V. Además se sabe que el λ que se obtiene se puede despreciar. Dibuje el modelo completo de pequeña señal del transistor para bajas frecuencias y calcule sus parámetros.
 - c) Dado el circuito de la figura de la derecha, obtener la polarización considerando $k=0.35\,\mathrm{mA~V^{-2}},~V_{\mathrm{T}}=-1\,\mathrm{V},~\lambda=0.13\,\mathrm{V^{-1}},~R_{\mathrm{G1}}=47\,\mathrm{k}\Omega,~R_{\mathrm{G2}}=33\,\mathrm{k}\Omega,~R_{\mathrm{D}}=4.7\,\mathrm{k}\Omega~\mathrm{y}~V_{\mathrm{DD}}=3.3~\mathrm{V}.$



- 2) a) Tres muestras de Silicio con misma geometría (largo y área) son dopadas con tres densidades de impurezas donoras distintas, obteniéndose tres valores de movilidad distintos: μ = {1400; 800; 300}cm²/(Vs). A cada una de ellas se le aplica la misma tensión V, obteniéndose 3 corirentes distintas circulando por cada muestra siendo I₁ > I₂ > I₃. Relacionar cada corriente obtenida con cada uno de los dopajes y movilidades. Explicar por qué varía la movilidad, indicando un valor aproximado de denisdad de dopaje para cada muestra. Justificar la respuesta.
 - b) Dos diodos son fabricados con el mismo material semiconductor y mismos niveles de dopaje, pero con distinta área siendo $A_{D_1}=100\times A_{D_2}=0.1~\mathrm{mm}^2$. Los diodos tienen como parámetros su densidad de corriente de saturación inversa $J_S=3~\mathrm{nA~cm}^{-2}$, la densidad de corriente de generación $J_{gen}=0.1~\mathrm{mA~cm}^{-2}$, y el coeficiente de idealidad n=1,2. Ambos están conectados como se muestra en la figura, donde $V_{DD}=3~\mathrm{V}$ y $R=100~\mathrm{M}\Omega$. Calcular de forma aproximada la caída de tensión y la corriente que circula por cada uno de los diodos. Indicar todas las aproximaciones e hipótesis utilizadas en la resolución.

